



Vol. 14, No. 1, 1385/2006 Spring & Summer

IRANIAN JOURNAL OF  
CRYSTALLOGRAPHY  
and MINERALOGY

## Study of the crystallization and dopants effect on the semiconducting thermoelectric compounds with $(Bi_{0.25} Sb_{0.75})_2 Te_3$ formula

G. Kavei, M. A. Karami

Material & Energy Research Center (MERC), Semiconductors Fabrication Division. P. O .Box 14155-4777, Tehran,  
Iran.

E-mail: g-kavei@merc.ac.ir

(Received:-- /--/----, received in revised form: -- /--/----)

**Abstract:** The  $(Bi_{0.25} Sb_{0.75})_2 Te_3$  compound is a p-type thermoelectric semiconductor for application in thermoelectric cooling systems. To fabricate this single crystal, required elements, Bi, Sb and Te with 5N purity melted in quartz capsule at  $10^{-6}$  torr pressure and rapidly quenched to room temperature. The sample crystallized by zone melting method with the rate of 8 mm per an hour at  $700^{\circ}\text{C}$  and for heat stress relieving annealed at  $370^{\circ}\text{C}$ . In this presentation; crystal growth process and effect of dopants on improving the thermoelectric property of crystals will be reported. Structural studies by XRD show the expected phases formed in single phase. Scanning electron microscopy (SEM) was used to characterize the quality of the crystal growth. Maximum figure of merit  $Z = 3.15 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$  in optimum condition was obtained.

**Keywords:** *Crystal Growth, thermoelectric Semiconductor, Figure of merit, Scanning Electron Microscopy.*





## مطالعه بلور و تاثیر آلاینده‌ها بر ترکیبات ترموالکتریکی نیمرسانا با فرمول $(\text{Bi}_{0.25}\text{Sb}_{0.75})_2\text{Te}_3$

قاسم کاواهای، مسعود الله کرمی

پژوهشگاه مواد و انرژی، بخش نیمرساناها، تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۴۷۷۷

پست الکترونیکی: g-kavei@merc.ac.ir

(دریافت مقاله ---/---/---، دریافت نسخه نهایی ---/---)

چکیده: ترکیب  $\text{Bi}_{0.25}\text{Sb}_{0.75}\text{Te}_3$  بلوری نیمرسانا با خاصیت ترموالکتریک نوع p برای کاربرد در سردکننده‌های ترموالکتریکی است. برای ساخت این تک بلور عناصر مورد نیاز Bi، Sb و Te با درجهٔ خلوص ۹۹.۹۹ در کپسول کواتز در خلاء  $10^{-6}$  torr اذوب و به سرعت تا دمای اتاق سرد می‌کنیم. بدین ترتیب محلول جامدی از این عناصر تهیه می‌شود. به منظور بلوری کردن، محلول جامد به دست آمده، به روش رشد ناحیه‌ای با آهنگ رشد  $8 \text{ mm/h}$  (سرعت حرکت کوره) در دمای  $700^{\circ}\text{C}$  رشد داده می‌شود و برای تنش‌زدایی نمونه‌ها در دمای  $370^{\circ}\text{C}$  به مدت ۲۴ ساعت تحت عملیات گرمایی قرار می‌دهیم. در این مقاله، فرایند رشد بلور و نقش مواد آلاینده در بهبود خواص ترموالکتریکی بررسی می‌شود. مطالعات ساختاری انجام شده با پرتو X، تشکیل فازهای مورد انتظار را نشان می‌دهد. برای مشخص کردن کیفیت رشد بلورها از تصاویر SEM استفاده می‌شود. بیشترین ضریب بهره در حالت بهینه  $Z = 3.15 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$  به دست می‌آید.

واژه‌های کلیدی: رشد بلور، نیمرسانای ترموالکتریک، ضریب بهره ترموالکتریکی، میکروسکوپ الکترونی رویشی.

کرده و درون یک لوله کوارتز که قطر داخلی ۸ میلیمتر که ته آن بسته و با الکل سفید و آب مقطر خالص تمیز شده است، می‌ریزیم. به منظور جلوگیری از نفوذ مواد به بدنه لوله کوارتز، و جدا شدن آسان نمونه از شیشه، دیواره داخلی لوله را با ۲ میلی‌لیتر استون آغشته کرده و با گرم کردن ته شیشه به وسیله شعله و حرکت شعله در طول لوله، دیواره سیاه، یعنی کربن اندود می‌شود. پیش از بستن آمپول، برای شستشوی محیط گازی محفظه سیستم، پس از خلاء سازی تا  $10^{-6}$  torr آرگون را وارد محفظه کرده به طوری که فشار محیط  $10^{-3}$  torr باشد و سیستم حدود ۵.۰ ساعت در این محیط باقی می‌ماند.

سپس، سر آمپول را بسته و آن را به صورت کپسول حاوی مواد خواهیم داشت. کپسول کوارتز حاوی مواد اولیه در داخل کوره افقی با شیب ملایم ۱۰ درجه که می‌تواند حرکت نوسانی طولی (۰.۸ نوسان در دقیقه) داشته باشد، قرار داده می‌شود. با توجه به نمودار فاز شبه دوتایی محلول جامد (شکل ۱) و با برنامه‌ای برای تغییر دما بر حسب زمان، و برنامه افزایش دما که در شکل ۲ نشان داده شده است دمای کوره تا  $200^{\circ}\text{C}$  بالا برده می‌شود. در این دما نمونه با یک دستگاه نوسانساز، به مدت یک ساعت نوسان داده [۱۰] و سپس از کوره خارج و به سرعت سرد (Quench) کردیم. به این ترتیب محلول جامد بهبود می‌شود. در شکل ۲ نشان داده شده است سرعت سرد کردن باعث تغییر در سرستیهای ترموالکتریکی می‌شود [۱۱].

رشد بلور (Bi<sub>0.25</sub> Sb<sub>0.75</sub>)<sub>2</sub> Te<sub>3</sub> به روش رشد ناحیه‌ای پس از تهیه محلول جامد، برای بهبود خواص ترموالکتریکی ماده، تبلور آن لازم است. از روش‌های مختلف رشد بلور، به طور مثال روش چگرالسکی، بریجمن، و رشد ناحیه‌ای را می‌توان انتخاب کرد. در مصارف حساس به ویژه احساسگرهای دمایی که خواص بلورین مهم است، از دو روش اول، و رشد ناحیه‌ای به علت اقتصادی بودن، آسانی و کافی بودن دقت در ساخت قطعات سرد کننده ترموالکتریکی معمولی، روشی است آرمانی و برای دستیابی به ساختار با یکنواختی قابل قبول، نمونه با این روش رشد داده می‌شود. اساس روش رشد به این صورت که پایین‌ترین بخش محلول جامد را به وسیله یک گرم کننده متحرک ذوب می‌کنیم. با جابجایی ناحیه گرم به سمت بالا، پایین‌ترین نقطه از مواد داخل کپسول منجمد می‌شود. در ادامه جابجایی کوره، صفحات بلور در پایین‌ترین بخش آن آبگون تشکیل شده و با ادامه این روند هر صفحه با توجه به

## مقدمه

محلولهای جامد بر پایه بیسموت تلواید (Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>) در سردکننده‌هایی که بر اساس اثر پلته کار می‌کنند، به صورت گستردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابر سرد کردن [۱۱]، رشد بلور به روش رشد ناحیه‌ای [۲۲]، آلیاژسازی مکانیکی [۳۳]، تزریق در قالب [۴۴]، و پرس گرم [۵۵] روش‌های مختلف مورد مطالعه برای ساخت قطعات ترموالکتریک هستند. این سردکننده‌ها در کاربردهای مختلف مثلاً خنک کردن مدارهای مجتمع الکترونیکی، لیزرهای، آشکارسازهای فروسخ، سرمازایی موضعی به ویژه در مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند [۶۶]. اخیراً تحقیقات روی مواد نانوترموالکتریک و احساسگرهای دمایی نیز در حال انجام است [۷۷]. یک دستگاه ترموالکتریک مشتمل از مجموعه قطعات نیمرسانانی نوع p و نوع n است که به طور رشتکی قرار می‌گیرند. هر قطعه‌ای ترکیبات و فرایند ساخت ویژه خود را دارد. هدف این تحقیق تهیه محلول جامد بلور نوع p و بررسی نقش آلاینده‌ها، روی خواص ترموالکتریک آن است. برای این منظور ترکیب بهینه (Bi<sub>0.25</sub> Sb<sub>0.75</sub>)<sub>2</sub> Te<sub>3</sub> که ضریب بهره بالاتری را نسبت به ترکیبات مشابه خود دارد [۸۸]، در ساخت بلور انتخاب می‌کنیم. پس از تهیه بلور سرستیهای ترموالکتریکی مثل رسانایی الکتریکی ۵، توان ترموالکتریک  $\alpha$  و رسانایی گرمایی  $\kappa$  برای تعیین ضریب بهره الکتریکی  $Z = \alpha / \kappa$  اندازه‌گیری می‌شود. بررسی بهبود خواص ترموالکتریک ماده با افزودن مواد آلاینده و Ag + Se + Te در مقدار مختلف انجام شده است. این مواد چگالی حفره‌ها در ترکیب ماده ترموالکتریک را بالاتر می‌برد، که این خود رسانش‌های الکتریکی و گرمایی را افزایش، و ضریب سی بک را کاهش می‌دهد به صورتی که ضریب بهره ماده ترموالکتریک  $Z = \frac{\alpha^2 \sigma}{K_{tot}}$  ) افزایش می‌یابد.

## روش آزمایش

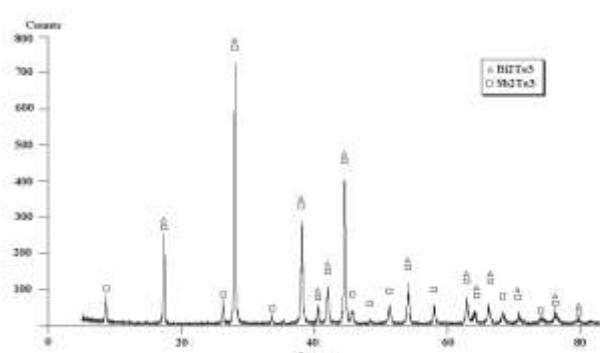
برای ساخت تک بلور Te<sub>3</sub> (Bi<sub>0.25</sub> Sb<sub>0.75</sub>)<sub>2</sub> با رعایت نسبت‌های شیمیایی مواد اولیه Sb و Bi با درصد خلوص ۹۹.۹۹٪ به همراه ۳ gr اضافی تلویم و مقداری مختلف آلاینده Te + Ag و Se با استفاده از ترازوی با دقت ۰.۱ gr توزین شدند. جرم عناصر به کار رفته در جدول ۱ ارائه شده است، مقداری اضافی Te با توجه به فشار نسبتاً بالای بخار آن انتخاب می‌شود [۹۹]. مواد اولیه را خرد

### تنش زدایی گرمایی

جهت تنش زدایی گرمایی و حذف بعضی نواقص احتمالی بلور، نمونه های ساخته شده به مدت ۲۴ ساعت در دمای  $370^{\circ}\text{C}$  قرار گرفته و سپس کوره به آرامی با آهنگ  $6^{\circ}\text{C}/\text{min}$  سرد می شود. به این ترتیب تنشهای گرمایی در نمونه رشد داده شده کاهش می یابد.

### اندازه گیری و بحث

شکل ۳ گرده (نقش) پراش XRD گرفته شده از نمونه پودر شده بلوری  $(\text{Bi}_{0.25} \text{Sb}_{0.75})_2 \text{Te}_3$  را نشان می دهد. مقایسه قله ها با کارتھای ASTM تشکیل فازهای  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  و  $\text{Sb}_2\text{Te}_3$  که به ترتیب در شکل با علامتهای  $\Delta$  و  $\square$  مشخص شده اند، را نشان می دهد. شکل ۴ تصویر SEM با باریکه الکترونی که انرژی آن  $25 \text{ keV}$  بوده است و بزرگنمایی های متفاوت از سطح بلور گرفته شده، چینش لایه های بلوری را روی هم نشان می دهد. مقادیر اندازه گیری شده رسانایی الکتریکی  $\sigma$  و توان ترموالکتریک  $\alpha$  و رسانایی گرمایی  $\kappa$  نمونه ها برای تعیین ضریب بهره ترموالکتریکی در جدول ۲ آورده شده است. ساز و کار عمل آلایش یعنی تغییر در سطوح انرژی عناصر اصلی به وسیله آلاینده ها در [۱۱] بررسی شده است. آلاینده های به کار رفته، خواص ترموالکتریکی نمونه را بهبود بخشیده اند به طوری که ضریب بهره از  $2.7 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$  در ماده آلاییده به  $3.15 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$  برای ماده آلاییده با  $0.1 \text{ mol}$   $\text{Te} + \text{Se}$  مطابق نمودار شکل ۵ افزایش می یابد.



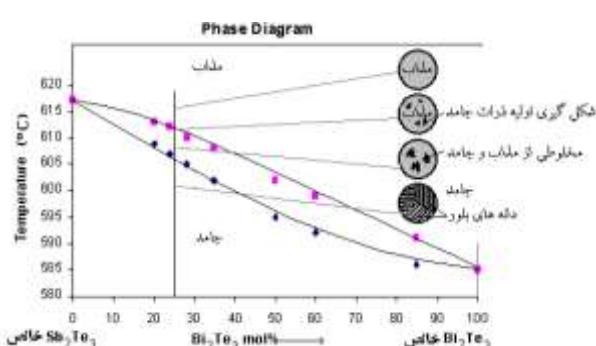
شکل ۳ الگوی پراش XRD با تابش  $\text{Cu}-\text{K}\alpha$  مربوط به پودر نمونه بدون آلاینده  $(\text{Bi}_{0.25} \text{Sb}_{0.75})_2 \text{Te}_3$ .



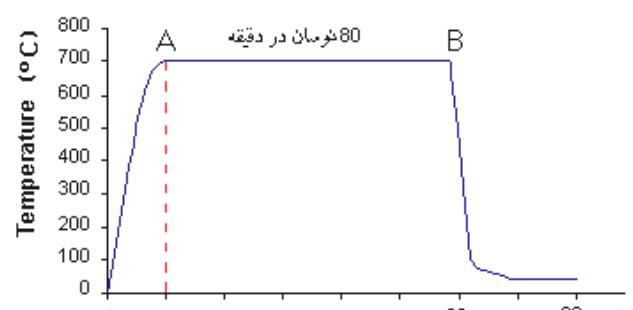
جهت گیری صفحه پایین تر خود متبلور می شود. تهی جاها و نواقص بلوری محلول جامد با این روش به سمت بالای بلور حرکت می کنند و در نهایت در انتهای آزاد بلور جمع می شوند. دمای کوره در حدود  $50^{\circ}\text{C}$  بالاتر از دمای ذوب محلول جامد انتخاب و ثابت نگه داشته می شود، که این بستگی به قطر لوله انتخاب شده است. هرچه قطر لوله بیشتر باشد این دما بر حسب تجربه بالاتر است. گرم کننده که ناحیه آبگون را ایجاد می کند با سرعت ثابت که بهینه مقدار آن  $8 \text{ mm/h}$  است به سمت بالا حرکت می کند. در صورت تکرار فرایند رشد، کیفیت نمونه بالا می رود ولی چندان اقتصادی نیست و این تکرار را می توان با تنش زدایی گرمایی جایگزین کرد.

جدول ۱ جرم مواد اولیه، ابعاد آمپول کوارتز و آهنگ رشد نمونه ها.

نمونه	$M_{\text{Te}}(\text{g})$	$M_{\text{Bi}}(\text{g})$	$M_{\text{Sb}}(\text{g})$	$M_{\text{Ag}}(\text{g})$	$M_{\text{Se}}(\text{g})$	$M_{\text{tot}}(\text{g})$
بدون آلاینده	۱۵۰.۳۵	۳.۸۹۹۲	۶.۸۱۵۶	-	-	۲۵.۷۴۹۸
۱٪ Ag	۱۵۰.۳۵	۳.۸۹۹۲	۶.۸۱۵۶	۰.۲۵۰	-	۲۵.۹۹۹۸
۰.۱٪ Ag	۱۵۰.۳۵	۳.۸۹۹۲	۶.۸۱۵۶	۰.۰۲۵۰	-	۲۵.۷۷۸
۰.۰۱٪ Ag	۱۵۰.۳۵	۳.۸۹۹۲	۶.۸۱۵۶	۰.۰۰۲۵	-	۲۵.۷۵۲۳
۱٪ Te+Se	۱۵۱.۶۰	۳.۸۹۹۲	۶.۸۱۵۶	-	۰.۱۲۵۰	۲۵.۹۹۹۸
۰.۱٪ Te+Se	۱۵۱.۴۷۵	۳.۸۹۹۲	۶.۸۱۵۶	-	۰.۰۱۲۵	۲۵.۷۷۴۸
۰.۰۱٪ Te+Se	۱۵۱.۳۶۲	۳.۸۹۹۲	۶.۸۱۵۶	-	۰.۰۰۱۲	۲۵.۷۵۲۲



شکل ۱ منحنی تغییرات فاز سیستم شبه دوتایی و مراحل تشکیل محلول جامد  $(\text{Bi}_{0.25} \text{Sb}_{0.75})_2 \text{Te}_3$ .



شکل ۲ نمودار برنامه تغییرات دما بر حسب زمان در کوره جهت تشکیل محلول جامد.

وآلاینده  $\text{Te} + \text{Se}$  با  $10\%$  درصد وزنی ماده، نشان می‌دهد که بهینه سازی خواص ماده تحقیقات وسیعی را می‌طلبد.

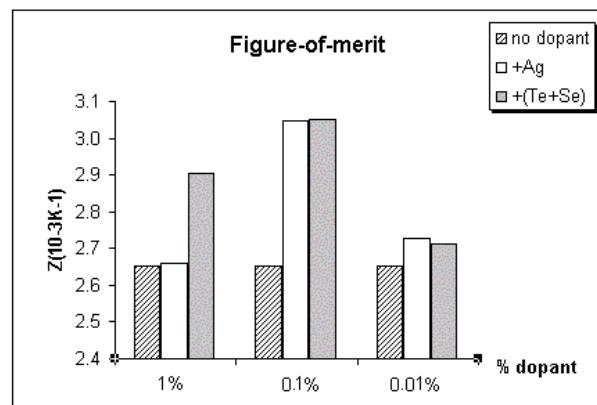
#### مراجع

- [1] E. Koukharenko, N. Frety, V. G. Shepelevich, J. C. Tedenac, "Thermoelectric properties of  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  material obtained by the ultrarapid quenching process route", *J. of Alloys and Compounds* 299 (2000) 254–257.
- [2] O. B. Sokolov, S. Ya. Skipidarov, N. I. Duvankovi, "The variation of the equilibrium of chemical reactions in the process of  $(\text{Bi}_2\text{Te}_3)(\text{Sb}_2\text{Te}_3)(\text{Sb}_2\text{Se}_3)$  crystal growth", *J. of Crystal Growth* 236 (2002) 181–190.
- [3] J. Yang, T. Aizawa, A. Yamamoto, T. Ohta, "Thermoelectric properties of  $p$ -type  $(\text{Bi}_2\text{Te}_3)_x(\text{Sb}_2\text{Te}_3)_{1-x}$  prepared via bulk mechanical alloying and hot pressing", *J. of Alloys and Compounds* 309 (2000) 225–228.
- [4] J. Seoa, D. Chob, K. Parkc, C. Leea, "Fabrication and thermoelectric properties of  $p$ -type,  $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$  compounds by ingot extrusion", *Materials Research Bulletin* 35 (2000) 2157–2163.
- [5] Taek-Soo Kim, Ik-Soo Kim, Taek-Kyung Kim, Soon-Jik Hong, Byong-Sun Chun, "Thermoelectric properties of  $p$ -type 25% $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ +75% $\text{Sb}_2\text{Te}_3$  alloys manufactured by rapid solidification and hot pressing", *Materials Science and Engineering* B90 (2002) 42–46.
- [6] Kin-ichi Uemura, "History of thermoelectricity development in Japan", *J. of thermoelectricity* No3, 2002.
- [7] X. B. Zhaoa, X. H. Ji, Y. H. Zhang, B. H. Lua O, "Effect of solvent on the microstructures of nanostructured,  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  prepared by solvothermal synthesis", *J. of Alloys and Compounds* 368 (2004) 349–352.
- [8] J. Yang, T. Aizawa, A. Yamamoto, T. Ohta, "Thermoelectric properties of  $(\text{Bi}_2\text{Te}_3)_x(\text{Sb}_2\text{Te}_3)_{1-x}$  prepared by bulk mechanical alloying and hot pressing", *J. of Alloys and Compounds* 309 (2000) 225–228.
- [9] Dow-Bin Hyun, Tae Sung Oh, Jong-Seung Hwang, Jae-Dong Shim, "Effect of excess Te addition on the thermoelectric properties of the 20%  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ -80%  $\text{Sb}_2\text{Te}_3$  single crystal and hot pressed alloy", *Scripta mater.* 44 (2001) 455–460

شکل ۴ تصاویر SEM گرفته شده از صفحات بلوری بازرسنامایی‌های مختلف.

جدول ۲ مقادیر مشخصه‌های ترموالکتریک اندازه‌گیری شده.

نمونه	$\sigma(\Omega.\text{cm})^{-1}$	$\alpha(\mu.\text{V.K}^{-1})$	$\kappa(\text{W.K}^{-1}.\text{m}^{-1})$	$Z(\times 10^{-3}\text{K}^{-1})$
بدون آلاینده	۲۴۳۲	۱۳۳.۹	۱.۵۱۹	۲,۶۵۴
۱%Ag	۳۴۱۱	۱۲۷.۸	۱.۴۹۳	۲,۶۶۱
۰.۱%Ag	۲۳۹۵	۱۲۵.۹	۱.۷۶۵	۳,۰۴۹
۰.۰۱%Ag	۳۷۴۶	۱۲۱.۶	۲.۰۲۹	۲,۷۲۹
۱%Te+Se	۳۰۰.۷	۱۴۱.۳	۱.۳۸۰	۲,۹۰۳
۰.۱%Te+Se	۲۰۱۹	۱۴۵.۸	۱.۳۶۳	۳,۱۵۱
۰.۰۱%Te+Se	۲۱۰۱	۱۴۰.۹	۱.۵۳۸	۲,۷۱۱



شکل ۵ تغییرات ضریب بهره برای نمونه‌های مختلف ساخته شده.

برداشت

برای تهیه یک قطعه ترموالکتریک بکارگیری یکی از روش‌های رشد، مانند روش ذوب ناحیه‌ای ضروری است. روش رشد ناحیه‌ای از لحاظ اقتصادی از دیگر روش‌های رشد به صرفه‌تر است. درک فرایند تهیه بلور از مرحله ذوب تا رشد و حصول نتایج قابل تکرار در گرو اطلاعات دقیق از نمودارهای فاز تعادل جامد - مایع و چگالی حامله‌ای این مواد است. اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی ضریب بهره در گستره  $Z = 2.7 \times 10^{-3}\text{K}^{-1}$  تا  $(\text{Bi}_{0.25}\text{Sb}_{0.75})_2\text{Te}_3 = 3.15 \times 10^{-3}\text{K}^{-1}$  به ترتیب برای ترکیب